未来社会創造事業(探索加速型) 「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域 年次報告書(探索研究)

令和 4 年度採択研究開発代表者

[研究開発代表者名:平本 俊郎]

[東京大学 生産技術研究所・教授]

[研究開発課題名:相補型インバータ向けシリコン系横型パワーMOSFETの開発]

実施期間: 令和6年4月1日~令和7年3月31日

§1. 研究開発実施体制

- (1) 「シリコン系横型パワーMOSFET の試作・評価」グループ(東京大学)
 - ① 研究開発代表者: 平本 俊郎 (東京大学生産技術研究所, 教授)
 - ②研究項目
 - ・ダイオードの設計・試作・評価
 - ・パワーMOSFET の設計・試作・評価

§2. 研究開発成果の概要

2050年の未来社会で活躍する新モビリティ(超小型 EV 等)や新ロボット等では、脱炭素のための高効率化パワー半導体デバイスが大量に用いられると予想される。 量産性・高信頼性・低コストの面から、未来社会で求められるパワー半導体材料としては、ワイドバンドギャップ半導体材料よりシリコンが圧倒的に有利であると考えられる。 本研究開発の目的は、未来社会の超小型 EV や小型ロボット等のモーターの駆動に適した小型・低コストのワンチップ相補型インバータの実現に向けて、新規の高効率なシリコン系横型パワー半導体デバイスの研究開発を行うことである。

新規の高効率パワーデバイスとして、本研究開発では新規構造を有する横型パワースーパージャンクション MOSFET を提案している。本デバイスの懸念点は、この新規構造が超小型 EV 等に要求される高い耐圧に耐えられるかどうかであった。令和 5 年度は、本研究で提案する新規構造を有するダイオードで高い耐圧が得られることを示したが、令和 6 年度は、新規構造をスーパージャンクション構造に適用したスーパージャンクションダイオードに関して TCAD シミュレーションを用いて設計した。さらに、本研究室のクリーンルームにて本ダイオードの試作をおこなった。試作ダイオードの耐圧の実測評価を室温で行った結果、スーパージャンクションの N 型層と P 型層の濃度を適切に制御することにより、目標の 600V を超える高い耐圧が得られることがわかった。以上から、本構造を有するパワーデバイスにおいて、高耐圧化は問題がないことを明らかにした。今後は、本構造を有する横型パワーMOSFET の設計・試作を行い、本提案デバイスの有用性を実証する予定である。

【代表的な原著論文情報】

なし